

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

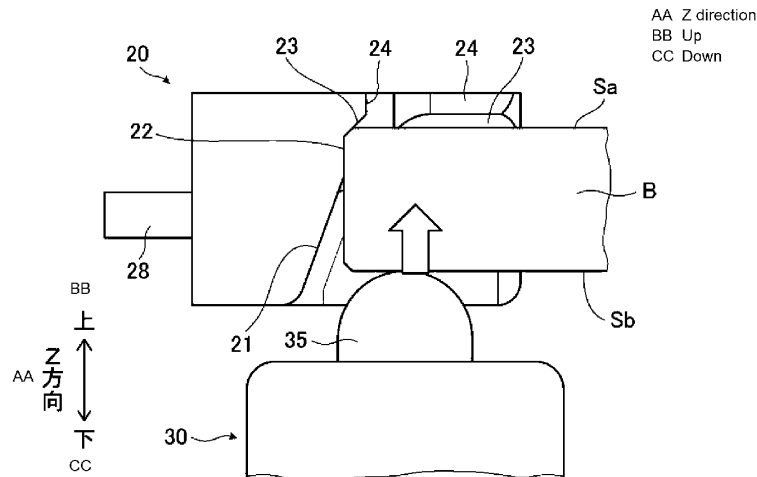
WO 2023/032721 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) C23C 14/50 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/031468
- (22) 国際出願日: 2022年8月19日(19.08.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-139521 2021年8月30日(30.08.2021) JP
- (71) 出願人: A G C 株式会社 (AGC INC.) [JP/JP];
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 仲村 壮太郎 (NAKAMURA Sotaro);
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 A G C 株式会社内 Tokyo (JP). 滝川 淳平 (TAKIKAWA Jumpei); 〒9630215 福島県郡

- 山市待池台一丁目8番地 A G C エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 加藤 沙弥 (KATO Saya); 〒9630215 福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 秋庭 一樹 (AKIBA Kazuki); 〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 A G C 株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人栄光特許事務所 (EIKOH PATENT FIRM, P.C.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イーストビルディング10階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,

(54) Title: SUBSTRATE-HOLDING DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING CONDUCTIVE-FILM-EQUIPPED SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 基板保持装置、及び導電膜付き基板の製造方法



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate-holding device including a mask member, a biaser, and a contact part. A contact member is provided with an inclined surface, an extending surface, and an abutting surface. A substrate is positioned by bringing the substrate, which is in a state of being biased by the biaser, and the mask member closer to each other in a first direction, guiding an outer edge section of the substrate to the abutting surface side along the inclined surface, and then causing the abutting surface to abut against the outer edge section of the substrate.

[続葉有]

KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明は、マスク部材と、付勢器と、接触部と、を有し、接触部材は、傾斜面と、延出面と、当接面と、を備え、付勢器により付勢された状態の基板、及びマスク部材を第1方向において互いに近接させて、傾斜面に沿って基板の外縁部を当接面側へ案内した後に、当接面を前記基板の外縁部と当接させることで基板を位置決めする、基板保持装置に関する。